

AUTOMATIC DIMENSIONING OF LAPPING MACHINE

Patent Number:

JP1045568

Publication date:

1989-02-20

Inventor(s):

OMORI TOSHIO; others: 01

Applicant(s):

MITSUBISHI METAL CORP; others: 01

Requested Patent:

JP1045568

Application Number: JP19870200584 19870811

Priority Number(s):

IPC Classification:

B24B37/04

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To improve dimensioning accuracy by compensating the detection value of feed per revolution of a lapping machine from the relation between a predicted lapping time and abrasion loss of the lapping machine at the time of initial lapping, and thereafter compensating the above relation based on the measured value of the number of lappings at the time of lapping. CONSTITUTION: When the thickness of a work W during lapping is evaluated from feed per revolution of a lapping machine 1, the detection value of feed per revolution of the lapping machine 1 is compensated from the relation between a predicted lapping time and abrasion loss of the lapping machine 1 (the relation obtained from the lapping operations performed up to that time) at the time of initial lapping. And thereafter at the time of lapping, the above relation between the predicted lapping time and abrasion loss is corrected based on the measured value of the thickness of the work W after lapping, the detection value of feed per revolution of the lapping machine 1 is compensated from the corrected relation, and as a result, the dimensioning accuracy can be improved.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-45568

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989)2月20日

B 24 B 37/04

D-7712-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 ラップ盤の自動定寸方法

②特 願 昭62-200584

郊出 願 昭62(1987)8月11日

⑫発 明 者 大 森 利 雄 千葉県野田市西三ケ尾金打314 日本シリコン株式会社野

田事業所内

⑫発 明 者 田 中 恵 一 千葉県野田市西三ケ尾金打314 日本シリコン株式会社野

田事業所内

⑪出 願 人 三菱金属株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番2号

⑪出 願 人 日本シリコン株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番2号

郊代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明細膏

1. 発明の名称

ラップ盤の自動定寸方法

2. 特許請求の範囲

ラップ盤の定盤送り量を検出し、その検出値に 基づきラッピング中の被加工物の厚さを求める自 動定寸方法において、

初期のラップ時は、ラップ時間とラップ盤の摩耗量との関係をそれまでに実施したラッピングで得られた関係から予想して、その予想した関係から、定盤送り量の検出値に、ラップ時間に応じたラップ盤の摩耗量相当の値を補正して、ラッピング中の被加工物の厚さを求め、

以降のラップ時は、ラップ終了後の被加工物の厚さの実測値によって、ラップ時間とラップ盤の摩託量との関係を補正し、補正したそれらの関係から、定盤送り量の検出値に、ラップ時間に応じたラップ盤の摩託量相当の値を補正して、ラッピング中の被加工物の厚さを求めることを特徴とす

るラップ盤の自動定寸方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、ラップ盤の定盤送り量から、被加工物の厚さを求めるラップ盤の自動定寸方法に関する。

[従来の技術]

従来の自動定寸装置付きのラップ盤は、上定盤を支持する円盤と、上定盤まわし金との間に、マグネスケール(商標名)のセンサーを備え、そしてそのセンサーによって、ラッピングに伴う上定盤の上下変位を検出し、その検出値を被加工物の厚さに変換して、自動定寸するようになっている。

[尭明が解決しようとする問題点]

ところが、従来のこのような定寸方法にあっては次のような問題があった。

(1)加工前におけるマグネスケールの 0 点設定が困難である。

すなわち、正確なマグネスケールの 0 点を設定 するためには、独加工物の厚さ"0"の状態でラッ ブ盤を加工状態としなければならない。 そのため、 ラップ加工圧力、速度(回転数)下での上下定盤の 共摺を必要とする。しかし、この上下定盤の共摺 は、定盤の損傷率が非常に高い。

(2)マグネスケールセンサーからの信号のパラツ キが大きいために定寸精度が極めて悪い。

すなわち、上定盤の変位を検出するセンサーの 信号は、回転する上定盤に接触しているため、ラップされる被加工物の厚さのバラツキや上定盤の高 さのアンバランスなどの影響から、測定精度が極 めて悪い。

(3)ラップに伴って定盤が摩耗するため、マグネスケールの 0 点が変動して、測定精度を悪化させる。

このようなことから、従来の方法の場合は定寸 精度が極めて悪かった。

[問題点を解決するための手段]

この発明のラップ盤の自動定寸方法は、ラップ 盤の定盤送り量を検出し、その検出値に基づきラッ ピング中の被加工物の厚さを求める自動定寸方法

ら、ラップ盤の送り量の検出値を補正し、以降の ラップ時は、ラップ後における被加工物の厚さの 実測値に基づいて、予測したラップ時間とラップ 盤の摩耗量の関係を修正し、そしてその修正した 関係から、ラップ盤の送り量の検出値を補正して、 結果的に定寸精度を上げる。

[実施例]

以下、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。

において、

初期のラップ時は、ラップ時間とラップ盤の既 耗量との関係をそれまでに実施したラッピングで 得られた関係から予想して、その予想した関係か ら、定盤送り量の検出値に、ラップ時間に応じた ラップ盤の摩耗量相当の値を補正して、ラッピン グ中の被加工物の厚さを求め、

以降のラップ時は、ラップ終了後の被加工物の厚さの実測値によって、ラップ時間とラップ盤の際・輸正し、補正したそれらの関係から、定盤送り量の検出値に、ラップ時間に応じたラップ盤の摩耗量相当の値を補正して、ラッピング中の被加工物の厚さを求めることを特徴とする。

[作用]

この発明のラップ盤の自動定寸方法は、ラップ盤の送り量からラッピング中の被加工物の厚さを求めるに当たって、まず、初期のラップ時は、予測したラップ時間とラップ盤の摩耗量との関係(それまでに実施したラッピングで得られた関係)か

合は、このセンサー 6 としてマグネスケールセンサーを採用している。センサー 6 の検出信号は、マグネスケール 7 からマイクロコンピュータ 8 が実際の定寸を引る。

次に、この発明の定寸方法について説明する。 本実施例においては、多数枚の被加工物Wをラッピング対象とし、そしてその被加工物Wを所定枚数ずつラッピングする場合について説明する。以下においては、ラップ盤lにセットした所定枚数の被加工物Wを所期の厚さにまでラッピングする作業を1単位として、その作業回数をラップ回数という。

まず、ラッピングに先立ち、ラッピング後の被加工物Wの厚さ、つまり目標とする被加工物Wの厚さを設定する(ステップSI)。そして、ラップ回数I回目は、ステップS2からステップS3へ進み、ここで被加工物Wの平均中心厚さを入力する。その後、マイクロコンピュータ8は、センサ

一 6 の検出データを取り込み(ステップS7)、モ 平 の データを取り込み(ステップS8)。この の データを取り返れた(ステップS8)。この の が の が な と 2 ・3 の 回転に伴ってセンサー 6 の り 処理は、定盤 2・3 の 回転に伴ってセンサー 6 の り 処理は、定盤 4 くの 平均値をとってセンサー 6 の 検出信号がある。検出信号なる。 検出信号なる。 で 5 ・1 の り の ら は、 平均処理した検出に 1 の り の と す る (ステップS9)。 第 3 回に は、 被 加 工 物 W の 厚 さ に 対 応 す る に 対 応 を 表 す の 検出信号と の 関係を表す。

ところで、マイクロコンピュータ8は、平均処理した検出データから被加工物Wの厚さを求めるに当たって、定盤2.3の摩託量を考慮する。

そこで、検出データと定盤 2 . 3 の摩耗量との 関係について説明する。検出データを単純に被加 工物 W の厚さに変換した場合には、それによって 求めた被加工物 W の厚さと、実際の厚さとの間に 誤差が生じる。その誤差とラッピング時間との関

採取した実験値から導き、またそのy切片は検出データの平均処理結果から求める。マイクロコンピュータ 8 は、このように想定した補正曲線に基づき、センサー 6 からの検出データを補正して被加工物 W の厚さを求める。つまり、検出信号を単純に変換して求めた被加工物 W の厚さとする訳である。

ステップS9における判定の結果、算出した被加工物wの厚さが目標の設定厚さに達しない時は、再びステップS7に戻って、同様の動作を繰り返す。ステップS9における判定の結果、算出した被加工物wの厚さが目標の設定厚さに達した時は、終了指令を発し(ステップSI0)、以降における同様のラップ作業の有無を判断する(ステップSI1)。次のラップ作業がないときは、ラップ作業を終了する。

次のラップ作業があるときには、ラップ終了後の被加工物 W の厚みを実測して、その実測値をマイクロコンピュータ 8 に入力する(ステップ S 1

係を定盤の雕札補正曲線として第5図に表す。こ の図から、時間に比例して定盤2.3の應耗量が 増加することが分かる。また、被加工物Wのサイ ズを変化させた場合にもグラフは、同様の勾配を もっ一次関数として表現できる(ただし、単位面 战当たりのラップ荷重は同一)。図中○の結線Ⅰ と、口の結線』は、共に同サイズの被加工物Wに ついての関係を表し、またそれとは異なるサイズ の被加工物₩についての関係を△の結線Ⅱによっ て表す。同サイズの被加工物Wについて異なる補 正曲線「、『ができる原因は、SINカーブとし て表現される検出デークの"0"点をそのSINカ ープ中の異なる位置にとったことによる。この* O[®]点位置のとり方によって、y切片にパラツキが 生じることになる。このパラツキは、検出データ の平均処理することによって小さく抑えられる。 マイクロコンピュータ8は、この1回目のラッ プ時においては、まず、上記のような定盤2.3 の摩耗量を考慮して第5図の摩耗量補正曲線を想 定する。想定した補正曲線の勾配は予め統計的に

2)。その後、再びステップS2に戻る。

以降は、2回目のラップが行なわれることになる。

この 2 回目のラップにおいては、ステップS 2 から、ステップS 4 、S 5 へ進む。このステップS 5 にては、ステップ 1 2 にて人力した酸加工物 Wの厚さの実測値に基づいて、第 5 図の摩耗量値 正曲線の y切片を設定する。そして、この 2 回目のラップ時は、このように設定した摩耗量値正曲線にしたがって、前述した 1 回目のラップ 糖正した はに、センサー 6 からの検出データを 糖正して 被加工物 Wの厚さを求める。

3回目のラップは、このような2回目のラップの終了後に、ステップ111、12からステップ2 へ再び戻って、2回目と同様のことを繰り返す。この3回目のラップ時においても2回目と同様に、ステップ5にて摩耗量補正曲線のy切片を再度設定する。その設定は、この2回目のラップに入る前のステップ12にて入力した被加工物Wの実測値に基づいて行う。そして、この3回目のラップ

特開昭64-45568 (4)

時は、このように設定した摩託量補正曲線にした がって、前述した1回目と同様にして被加工物 W の厚さを求める。

5 回目以降は、 4 回目と同様のステップにした がってのラップを繰り返す。

[発明の効果]

以上説明したように、この発明のラップ盤の自動定寸方法は、初期のラップ時は、予測したラップ時間とラップ盤の摩託量との関係(それまでに

3 ……下定盤、 6 ……センサー、

8 … … マイクロコンピュータ、

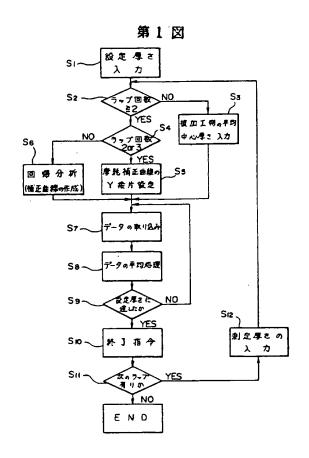
W……被加工物。

出願人 三菱金属株式会社

4. 図面の簡単な説明

図はこの発明の一実施例の説明図であり、第1 図は定寸方法の手順を表すフローチャート、第2 図はこの発明を実施する装置の既略構成図、第3 図はセンサーの検出信号の変化曲線図、第4図はセンサーの検出信号の局所的な変化特性を説明するための図、第5図は摩耗量補正曲線の説明図である。

- 1 … … ラップ盤、 2 … … 上定盤、



特開昭64-45568 (5)

